

НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТОПЛАЗМЕННЫЕ ВОЛНЫ В СТРУКТУРЕ ДИЭЛЕКТРИК—ПОЛУПРОВОДНИК—ДИЭЛЕКТРИК

С. И. Ханкина, В. М. Яковенко

В последние годы активно исследуются волновые процессы в плазме полупроводников ограниченных размеров. Интерес к этим явлениям обусловлен возможностями их использования в различных областях радиофизики и в полупроводниковой электронике (СВЧ спектроскопия, генерирование, усиление и преобразование волн). Подавляющее большинство работ посвящено линейной теории. Однако в полупроводниковой плазме даже при небольших величинах электрического поля начинают проявляться нелинейные эффекты. Природа нелинейных эффектов может быть самой различной, связанной как с поведением электронной системы, так и с особенностями кристаллической решетки, но роль их в волновых процессах одна и та же. В процессе нелинейной эволюции поля либо изменяется закон дисперсии волны, либо происходит ее распад и слияние с другими типами волн.

В предлагаемой работе исследуются нелинейные изменения дисперсии, приводящие к образованию уединенных волн в замагниченной полупроводниковой пластине*. Постоянное магнитное поле H_0 параллельно поверхности пластины и направлено вдоль оси Oz . Пластина занимает пространство $0 \leq y \leq a$, область $y \leq 0$ — среда (диэлектрик) с проницаемостью ϵ_1 , а область $y > a$ — среда с проницаемостью ϵ_3 . Вдоль осей x и z система предполагается безграничной. В такой системе могут существовать квазистатические магнитоплазменные волны, дисперсия которых обусловлена конечными размерами пластины. В этом случае система уравнений, описывающая электромагнитные свойства полупроводниковой плазмы, имеет вид

$$\operatorname{rot} E = 0, \quad \operatorname{div} \epsilon_0 E = 4\pi en; \quad (1)$$

$$e \frac{dn}{dt} + \operatorname{div} j = 0, \quad j = e(n_0 + n)v, \quad (2)$$

$$\frac{dp}{dt} = eE + \frac{e}{c} [vH_0]; \quad (3)$$

$$v_x = \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial p}, \quad \mathcal{G} = \left[\left(\epsilon_g^2 + \frac{\epsilon_g p^2}{m} \right)^{1/2} - \epsilon_g \right]. \quad (4)$$

Здесь ϵ_0 — диэлектрическая постоянная решетки, e — заряд, \mathcal{G} — энергия, m , p , v — эффективная масса, квазиимпульс и скорость электронов вблизи дна зоны проводимости, n — отклонение их концентрации от равновесного значения n_0 , ϵ_g — ширина запрещенной зоны. Приведенный закон дисперсии носителей (4) реализуется в узкозонных полупроводниках InSb, PbTe и т. д.

Нелинейные механизмы связаны как с непараболичностью законов дисперсии носителей, так и с характером уравнения движения, которое при $p^2/2m\epsilon_g \ll 1$ имеет вид

$$\frac{\partial p}{\partial t} = eE + \frac{e}{mc} [pH_0] - \left(\frac{p}{m} \nabla \right) p - \frac{e}{mc} \frac{p^3}{p^2} [pH_0], \quad (5)$$

$$\tilde{p}^2 = 2m\epsilon_g.$$

На границах раздела выполняются условия непрерывности тангенциальных составляющих электрического поля и нормальных компонент суммарного тока (тока смещения $\epsilon_0(\sigma E_y/\partial t)$ и тока проводимости $en_0 v_y$).

Зависимость от координат и времени всех переменных величин, входящих в уравнения (1)–(3) и граничные условия, представим в виде $\exp[i(k_x x + k_y y - \omega t)]$ (прямые волны). Воспользовавшись граничными условиями на плоскостях $y=0$, $y=a$ и условиями излучения при $y \rightarrow \pm\infty$, получим в линейном приближении следующее дисперсионное уравнение:

$$\left[\epsilon_1 \epsilon_3 + \epsilon_{xx}^2 + \epsilon_{xy} + i \frac{k_x}{|k_x|} \epsilon_{xy} (\epsilon_3 - \epsilon_1) \right] \operatorname{th} |k_x| [a + \epsilon_{xx} (\epsilon_1 + \epsilon_3)] = 0, \quad (6)$$

$$\epsilon_{xx} = \epsilon_0 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2 - \omega_H^2}, \quad \epsilon_{xy} = -\frac{i\omega_0^2 \omega_H}{\omega(\omega^2 - \omega_H^2)}, \quad \omega_0^2 = \frac{4\pi e^2 n_0}{m}, \quad \omega_H = \frac{eH_0}{mc}.$$

* Нелинейные свойства волн в слоях полупроводниковой и газоразрядной плазмы в отсутствие магнитного поля рассматривались в работах [1, 2].

** На практике широко используются МДП-структуры, но если толщина диэлектрика много больше длины волны, то влиянием металла на распространение волн в полупроводнике можно пренебречь.

Видно, что в рассматриваемой структуре при $\epsilon_1 \neq \epsilon_3$ волны обладают свойствами не-взаимного распространения относительно H_0 , так как при изменении k_x на $-k_x$ меняется вид дисперсионного уравнения. Кроме того, от направления распространения, как будет показано ниже, зависит возможность образования солитонов магнитоплазменных волн.

Наиболее важным с точки зрения практических приложений является случай тонкой пластины, когда ее толщина много меньше длины волны ($|k_x|a \ll 1$). Это обстоятельство существенным образом упрощает процедуру построения нелинейного уравнения, описывающего пространственно-временную эволюцию амплитуды волны. Для малых размеров пластины все переменные величины в уравнениях (1)–(3) и граничных условиях на плоскости $y=a$ можно разложить в ряд Тейлора по степеням a . Принимая также во внимание потенциальный характер колебаний и то обстоятельство, что возмущения электронной концентрации локализованы на поверхности образца ($\text{div } \mathbf{v}_{y=0} = 0$), можно избавиться от переменной y , а величины

$\partial E_x(x, t)/\partial t$ и $\partial E_y(x, t)/\partial t$ выразить через компоненты квазипульса p_x, p_y и их производные по переменной x . Подставляя эти выражения в проинтегрированное по времени уравнение (5), получим для p_x и p_y систему нелинейных дифференциальных уравнений, которую решаем методом, изложенным в [8]. Решение ищем в виде

$$P = \sum_k C_k(x, t)(p_k + p'_k) \exp [i(k_x x - \omega_k t)], \quad (7)$$

где p_k — безразмерный орт-вектор, p'_k — ортогональная к p_k добавка, связанная с нелинейными членами. Зависимость амплитуды от координаты и времени предполагается медленной, т. е. выполняются условия

$$\frac{1}{C} \frac{\partial C}{\partial t} \ll \omega, \quad \frac{1}{C} \frac{\partial C}{\partial x} \ll kx. \quad (8)$$

В этих предположениях для амплитуды C получено дифференциальное уравнение, описывающее ее изменение в пространстве и времени в результате отклика третьего порядка:

$$i \frac{\partial C}{\partial \tau} + \alpha \frac{\partial^2 C}{\partial \xi^2} + \beta |C|^2 C = 0. \quad (9)$$

Переменные τ и ξ связаны с t и x соотношениями $\tau = t$, $\xi = x - v_{rp}t$ (v_{rp} — групповая скорость волны).

Задача Коши для уравнения (9) решается точно по методу обратной задачи рассеяния [4, 5]. При одинаковых знаках перед второй производной и нелинейным членом ($\alpha\beta > 0$) в системе могут возникать солитоны. Если знаки α и β не совпадают ($\alpha\beta < 0$), то стационарными решениями (9) могут быть антисолитоны [1, 5–7].

В структуре диэлектрик—полупроводник—диэлектрик (металл) образование солитонов или антисолитонов магнитоплазменных волн зависит от соотношения между величинами диэлектрических проницаемостей сред, окружающих пластину, и диэлектрической постоянной полупроводника, а в случае несимметричного окружения ($\epsilon_1 \neq \epsilon_3$) — также и от направления распространения волны ($k_x > 0$ или $k_x < 0$) относительно постоянного магнитного поля. Эти выводы, например, следуют из условий существования уединенных волн в области высоких частот

$$\omega = \sqrt{\omega_H^2 + \frac{\omega_0^2}{\epsilon_0} + \frac{\omega_0^2 (\epsilon_1 - \epsilon_0 (|k_x|/k_x)) (\epsilon_3 + \epsilon_0 (|k_x|/k_x))}{2\omega_H \epsilon_0^2 (\epsilon_1 + \epsilon_3)}} |k_x| a - \frac{(\epsilon_0^2 + \epsilon_1 \epsilon_3) k_x a^2 \omega_0^2}{2\omega_H \epsilon_0^2 (\epsilon_1 + \epsilon_3)^2} \left(\epsilon_1 - \epsilon_0 \frac{|k_x|}{k_x} \right) \left(\epsilon_3 + \epsilon_0 \frac{|k_x|}{k_x} \right) \quad (| \omega_H | > \omega_0^2 / \epsilon_0), \quad (10)$$

которые приведены в табл. 1.

В этом случае коэффициент перед нелинейным членом в (9) имеет вид

$$\beta = \frac{2}{\omega} \left(\frac{k_x^2 \omega_0^2}{\epsilon_0 m^2 \omega_H^2} + \frac{2\omega_H^2}{\rho^2} \right) \cos^2 \varphi > 0 \quad (11)$$

(φ — угол между направлением квазипульса и осью Ox).

Первое слагаемое в (11) индукционного происхождения, второе — решеточного. В полупроводниковой плазме нелинейность, определяемая неквадратичностью закона дисперсии носителей, может играть основную роль. (В плазменном слое она, естественно, отсутствует и нелинейность имеет индукционный характер.)

Если одной из сред, граничащих с полупроводниковой пластиной, является металл ($\epsilon_1 \rightarrow \infty$), то дисперсионное уравнение в линейном приближении запишется в виде

$$\left(\epsilon_3 - i \frac{|k_x|}{k_x} \epsilon_{xy} \right) \text{th} |k_x| a + \epsilon_{xx} = 0 \quad (12)$$

Таблица 1
 $(\omega^2 \approx \omega_H^2 + \omega_p^2/\epsilon_0)$

$\epsilon_1 \neq \epsilon_3$	β	$v_{гп}$	α	sign $\alpha\beta$	$ C_{ноп} ^2$
$\epsilon_1 \neq \epsilon_3$		$\frac{a\omega_0^2}{2\omega_H} \text{sign } k_x \times$ $\times \frac{(\epsilon_1 - \epsilon_0)(k_x /k_x)}{\epsilon_0^2(\epsilon_1 + \epsilon_3)} (\epsilon_3 + \epsilon_0)(k_x /k_x)$	$\frac{\omega_0^2}{2 \omega_H } \frac{a^2(\epsilon_0^2 + \epsilon_1\epsilon_3)}{\epsilon_0^2(\epsilon_1 + \epsilon_3)^2} \times$ $\times (\epsilon_1 - \epsilon_0)(k_x /k_x) (\epsilon_3 + \epsilon_0)(k_x /k_x)$	$\left. \begin{array}{l} k_x > 0, \epsilon_1 > \epsilon_0 \\ k_x < 0, \epsilon_3 > \epsilon_0 \end{array} \right\} \alpha\beta > 0$ $\left. \begin{array}{l} k_x > 0, \epsilon_1 < \epsilon_0 \\ k_x < 0, \epsilon_3 < \epsilon_0 \end{array} \right\} \alpha\beta < 0$	$k_x > 0$ $\frac{\tilde{\pi}^2 \tilde{p}^2}{4\omega_0^2 \tau^2} \frac{\epsilon_0(\epsilon_0^2 + \epsilon_1\epsilon_3)}{(\epsilon_0 + \epsilon_3) \epsilon_1 - \epsilon_0 }$ $k_x < 0$ $\frac{\tilde{\pi}^2 \tilde{p}^2}{4\omega_0^2 \tau^2} \frac{\epsilon_0(\epsilon_0^2 + \epsilon_1\epsilon_3)}{(\epsilon_0 + \epsilon_1) \epsilon_3 - \epsilon_0 }$
$\epsilon_1 = \epsilon_3$	$\frac{4}{\epsilon_2} \left \frac{p_{гп}^2}{H} \right $	$\frac{a\omega_0^2}{4 \omega_H } \text{sign } k_x \times$ $\times \frac{(\epsilon_1^2 - \epsilon_0^2)}{\epsilon_0^2 \epsilon_1^2}$	$\frac{\omega_0^2}{8\omega_H} \frac{a^2(\epsilon_0^2 + \epsilon_1^2)(\epsilon_1^2 - \epsilon_0^2)}{\epsilon_0^2 \epsilon_1^2}$	$\left. \begin{array}{l} \epsilon_1^2 > \epsilon_0^2 \\ \epsilon_1^2 < \epsilon_0^2 \end{array} \right\} \alpha\beta > 0$ $\left. \begin{array}{l} \epsilon_1^2 < \epsilon_0^2 \\ \epsilon_1^2 > \epsilon_0^2 \end{array} \right\} \alpha\beta < 0$	$\frac{\tilde{\pi}^2 \tilde{p}^2}{4\omega_0^2 \tau^2} \frac{\epsilon_0(\epsilon_0^2 + \epsilon_1^2)}{ \epsilon_1^2 - \epsilon_0^2 }$
$\epsilon_1 \uparrow 8$		$\frac{a\omega_0^2}{2 \omega_H } \text{sign } k_x \times$ $\times \frac{\epsilon_0^2}{\epsilon_3 + \epsilon_0(k_x /k_x)}$	$\frac{\omega_0^2}{2 \omega_H } \frac{a^2 \epsilon_3 (\epsilon_3 + \epsilon_0)(k_x /k_x)}{\epsilon_0^3}$	$\left. \begin{array}{l} k_x > 0 \\ k_x < 0, \epsilon_3 > \epsilon_0 \end{array} \right\} \alpha\beta > 0$ $k_x < 0, \epsilon_3 < \epsilon_0 \left. \right\} \alpha\beta < 0$	$k_x > 0$ $\frac{\tilde{\pi}^2 \tilde{p}^2}{4\omega_0^2 \tau^2} \frac{\epsilon_0 \epsilon_3}{\epsilon_0 + \epsilon_3}$ $k_x < 0$ $\frac{\tilde{\pi}^2 \tilde{p}^2}{4\omega_0^2 \tau^2} \frac{\epsilon_0 \epsilon_3}{ \epsilon_3 - \epsilon_0 }$

и результаты для этого случая приведены в третьем разделе таблицы.

Процесс образования солитонов и антисолитонов является пороговым. Если амплитуда начального импульса меньше критической, то в результате пространственной дисперсии происходит распыливание начального возмущения. Пороговое значение амплитуды $C_{\text{пор}}$ определяется условием [8]

$$(C_{\text{пор}} b)^2 = \frac{\pi^2}{2} \frac{|\alpha|}{|\beta|}, \quad (13)$$

$b = v_{\text{гр}} \tau$ — ширина начального импульса.

При $\tau = 20$ нс, $\omega_0 / \sqrt{\epsilon_0} \sim 10^{12} \text{ с}^{-1}$, $|\omega_H| = 3 \cdot 10^{12} \text{ с}^{-1}$, $\epsilon_g = 0,1$ эВ, $m = 10^{-29} \text{ г}$, $|C_{\text{пор}}| \sim 10^{-22} \text{ г} \cdot \text{см} \cdot \text{с}^{-1}$, т. е. $|v_{\text{пор}}| \sim 10^7 \text{ см} \cdot \text{с}^{-1}$.

В заключение необходимо отметить, что в данной работе рассматривалась эволюция амплитуды сигнала, заданной в начальный момент времени. Можно показать, что выражение (9) преобразуется к уравнению, описывающему нелинейное распространение волнового пакета, заданного на границе полупроводникового образца (граничная задача). Это обстоятельство важно для возбуждения магнитоплазменного солитона в экспериментальных условиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ханкина С. И., Яковенко В. М. // Изв. вузов. Радиофизика. 1984. Т. 27. № 6. С. 795.
2. Владимиров С. В. // Физика плазмы. 1986. Т. 12. Вып. 8. С. 961.
3. Галеев А. А., Карпман В. И. // ЖЭТФ. 1963. Т. 44. № 2. С. 592.
4. Захаров В. Е., Манаков В. С., Новиков С. П., Питаевский Л. П. Теория солитонов: метод обратной задачи. — М.: Наука, 1980. — 320 с.
5. Захаров В. Е., Шабат А. В. // ЖЭТФ, 1973. Т. 64. Вып. 5. С. 1625.
6. Лукомский В. П. // УФЖ. 1978. Т. 23. № 1. С. 134.
7. Владимиров С. В., Цытович В. Н. // Физика плазмы. 1985. Т. 11. Вып. 12. С. 1458.
8. Беспалов В. И., Таланов В. И. // Письма в ЖЭТФ. 1966. Т. 3. С. 471.
9. Виноградова М. Б., Руденко О. В., Сухоруков А. П. Теория волн. — М.: Наука, 1979. — 383 с.

Институт радиофизики и электроники
АН УССР

Поступила в редакцию
19 октября 1987 г.